PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-293534

(43) Date of publication of application: 05.11.1996

(51)Int.CI.

H01L 21/68

(21)Application number : 07-120866

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

TOKYO ELECTRON KYUSHU KK

(22)Date of filing:

20.04.1995

(72)Inventor: IWASAKI TATSUYA

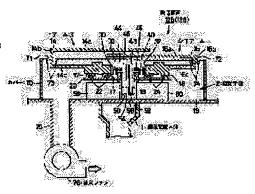
OTA YOSHIHARU TATEYAMA KIYOHISA

(54) CONVEYING DEVICE FOR MATERIAL TO BE TREATED

(57)Abstract:

PURPOSE: To effectively remove the particles generated in a driving means of a conveying device on which a conveying path is attached to the main body of a freely movable conveying device through a driving means and the material to be treated is delivered by moving an arm in forward and backward directions by the operation of the driving means.

CONSTITUTION: The leaking to outside a cover 70 of the particles, generated by a driving means 2 operated when the material to be treated is delivered, is prevented by providing a cover 70, which covers the driving means 2, and a sucking means which sucks inside the cover 70.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of

20.05.2003

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号

特開平8-293534

(43)公開日 平成8年(1996)11月5日

Α

(51) Int.Cl.⁸

HO1L 21/68

識別記号

庁内整理番号

FΙ

H01L 21/68

技術表示箇所

DOMEST NEWS

審査 簡求 未請求 請求項の数3 FD (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平7-120866

(22)出願日

平成7年(1995)4月20日

(71)出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(71)出顧人 592104715

東京エレクトロン九州株式会社

佐賀県鳥栖市西新町1375番地41

(72)発明者 岩▲崎▼ 達也

加本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京

エレクトロン九州株式会社館本事業所内

(72)発明者 太田 義治

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京

エレクトロン九州株式会社熊本事業所内

(74)代理人 弁理士 萩原 康司 (外2名)

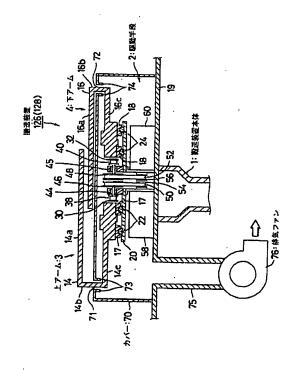
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被処理体の搬送装置

(57)【要約】

【目的】 搬送路を移動自在な搬送装置本体1に駆動手段2を介して取り付けられ、該駆動手段2の稼働によりアーム3、4を進退させて被処理体Pの受け渡しを行うように構成された搬送装置126において、駆動手段2において発生したパーティクルを効果的に除去する。

【構成】 駆動手段2を覆うカバー70と、該カバー70内を吸引する吸引手段76を設けることにより、被処理体Pの受け渡しを行う際に駆動手段2が稼働することによって発生したパーティクルがカバー70の外部に漏れ出ることを防止する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 搬送路を移動自在な搬送装置本体に駆動手段を介して取り付けられ、該駆動手段の稼働によりアームを進退させて被処理体の受け渡しを行うように構成された搬送装置において、前記駆動手段を覆うカバーと、該カバー内を吸引する吸引手段を設けたことを特徴とする、被処理体の搬送装置。

【請求項2】 前記カバーにはアームが嵌入するスリットが形成されており、該スリットの下方にカバー内の気密性を高めるためのスカートが設けられている、請求項 101に記載された被処理体の搬送装置。

【請求項3】 前記駆動手段がベルト駆動手段であり、 該ベルト駆動手段を構成する部材が前記カバー内に配置 されている、請求項1または2に記載された被処理体の 搬送装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LCD基板や半導体ウェハなどの被処理体を搬送するための搬送装置に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば、LCD基板や半導体ウェハなどの製造においては、被処理体であるLCD基板や半導体ウェハの上面にレジストバターンを形成させるために、いわゆるリソグラフィ処理が行われる。このリソグラフィ処理は、被処理体の洗浄、被処理体の表面へのレジストの塗布、そのレジストの露光、現像など、種々の処理工程を含んでいる。

【0003】これらの処理工程行うための各処理装置を一カ所に集約したシステムでは、所定枚数の被処理体を収納しているカセットから取り出された被処理体を、洗浄装置、レジストコータ、現像処理装置などといった各処理装置の間で一枚づつ搬送し、その受け渡しを行う搬送装置が設けられている。かような搬送装置は、搬送路を移動自在な搬送装置本体に駆動手段を介して取り付けられ、搬送装置本体によって所定の位置に移助した後、駆動手段の稼働によって各処理装置に対して搬送用のアームを進入、退出させて被処理体の受け渡しを行うように構成されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】以上のような搬送装置において、アームを進退させる駆動手段としては例えばベルト駆動手段などが広く用いられている。ところが、ベルト駆動手段などを用いるとバーティクルが発生しやすいといった問題が生じる。特に、LCD基板などのような大型の被処理体を搬送する搬送装置では、基板の重量が重いために駆動手段にかかる負荷が大きく、バーティクルが発生しやすい。こうして発生したバーティクルが被処理体に付着すると、デバイス性能の劣化、歩留まりの低下といった問題を引き起こす。

【0005】従って本発明は、駆動手段において発生したパーティクルを効果的に除去できる機構を備えた搬送 装置を得ることを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、前述の如く搬送路を移助自在な搬送装置本体に駆助手段を介して取り付けられ、該駆助手段の稼働によりアームを進退させて被処理体の受け渡しを行うように構成された搬送装置において、前記駆助手段を覆うカバーと、該カバー内を吸引する吸引手段を設けたことを特徴としている。

【0007】この装置においては、前記カバーにアームを恢入させるためのスリットを形成し、該スリットの下方にカバー内の気密性を高めるためのスカートを設けることができる。また、前記駆動手段をベルト駆動手段とし、該ベルト駆動手段の構成部材を前記カバー内に配置する構成とすることが可能である。

[8000]

【作用】本発明の搬送装置によれば、アームを進退させるための駆動手段がカバーで覆われているので、被処理 20 体の受け渡しを行う際に駆動手段が稼働することによって発生したバーティクルがカバーの外部に漏れ出ることを防止できる。従って、本発明の搬送装置によれば、駆動手段において発生したバーティクルを搬送中に被処理体に付着させることなく排除でき、被処理体を清浄な状態で、各処理装置の間で授受することができるといった特徴がある。

[0009]

【実施例】以下に、本発明の実施例を説明する。先ず、 図4をもとにして処理システム全体から説明する。との 処理システムでは、被処理体としてのLCD基板Pを搬 入・搬出するローダ・アンローダ部(カセット・ステー ション)100、LCD基板Pをブラシ洗浄するブラシ 洗浄装置102、LCD基板Pを高圧ジェット水で洗浄 するジェット水洗浄装置104、LCD基板Pの表面を 疏水化処理するアドヒージョン処理装置110、LCD 基板Pを所定温度に冷却する冷却装置108、LCD基 板Pの表面にレジストを塗布するレジスト塗布装置 1 1 2、レジスト塗布の後LCD基板Pを加熱してプリベー クまたはポストベークを行う加熱装置 114、LCD基 40 板Pの周縁部のレジストを除去するレジスト除去装置 1 16、および露光後にLCD基板P上のレジスト障につ いて現像・リンスを行う現像装置106を一体的に集合 化して作業効率の向上を図っている。

【0010】システムの中央部には、長手方向に配置された廊下状の搬送路120、122が受け渡し部124を介して一直線上に設けられている。各処理装置102~116は搬送路120、122に基板の出入口を向けて配設され、第1の搬送装置126がローダ・アンローダ部100、処理装置102~108および受け渡し部50 124との間でLCD基板Pの受け渡しを行うために搬

送路120上を移跡し、第2の搬送装置128が受け渡 し部124および処理装置108、110~116との 間でLCD基板Pの受け渡しを行うために搬送路122 上を移動するようになっている。各搬送装置126.1 28は、後述するように一対のアームを有しており、各 処理装置102~116のチャンバにアクセスするとき は一方のアームでチャンバから処理済みのLCD基板P を搬出し、他方のアームで処理前のLCD基板Pをチャ ンバに搬入する。

【0011】ローダ・アンローダ部100には、LCD 10 基板Pを所定枚数たとえば25枚ずつ収納して一括搬入 ・搬出するための基板カセットCを所定位置に(たとえ ば図示のように4個一列に) 載置するカセット載置台] 00aと、各カセットCから処理すべきLCD基板Pを 取り出し、処理済みのLCD基板Pを各カセットへ戻す ローダ・アンローダ部搬送装置130が設けられてい る。とのローダ・アンローダ部搬送装置130は、本体 132によってカセットCの配列方向に移動し、本体1 32に搭載された板片状のピンセット134によって各 カセットC内にアクセスするようになっている。ピンセ 20 ット134には、複数個たとえば4個の孔134aが形 成されており、第1の搬送装置126との間でLCD基 板Pの受け渡しが行われるときはこれらの孔134aを 通って4本の基板支持ピン136がピンセット134の 上面(基板載置面)より上方に突出するようになってい る。また、ピンセット134の両側には、LCD基板P の四隅を保持して位置合わせ(アライメント)を行う基 板位置合わせ装置138も併設されている。

【0012】次に、図1~図3を参照して本発明の実施 例における搬送装置126、128について説明する。 なお、搬送装置126と搬送装置128は同様の構成を 備えているので、以下、搬送装置126について説明 し、搬送装置128についての説明は省略する。図1は 搬送装置126の略平面図、図2は搬送装置126の基 端部の構成を示す縦断面図、図3は搬送装置126の先 端部の構成を示す縦断面図である。

【0013】この搬送装置126は、搬送路120に沿 って移動し、任意の位置において昇降自在に構成された 搬送装置本体1と、該搬送装置本体1の上に、駆動手段 備えている。搬送装置本体1の稼働により、これら駆助 手段2と上アーム3及び下アーム4は、搬送路120に 沿って一体的に移動すると共に、任意の位置において― 体的に昇降し、かつ水平面内において一体的に回転す る。また、駆動手段2の稼働により、上アーム3及び下 アーム4は、それぞれが独立して図1の矢印X方向(図 2、3においては図面に垂直方向)に進退する構成にな っている。なお、搬送装置本体1は従来公知の慣用手段 で構成されるため、図1~図3では搬送装置126の上 下アーム3、4及び駆動手段2の構成のみを示し、搬送 50 【0018】従って、モータ58の回転軸が回転する

装置本体] についての具体的な構成については図示して いない。

【0014】図示のように、本実施例の上アーム3及び 下アーム4は、平面視でコ字状をなす上アーム先端部) 0 および下アーム先端部12を有している。なお、図1 では、下アーム先端部12が上アーム先端部10の下に 隠れて見えない。上アーム先端部10には、図1に示す ように、LCD基板Pの四隅を保持するための突起状の 基板保持部10aが設けられている。下アーム先端部1 2にも同様の基板保持部12a (図示せず) が設けられ ている。これら上アーム先端部10および下アーム先端 部12の基端側は、アーム支持フレーム14、16の上 水平部14a、16aの下面にそれぞれ固着されてい る。アーム支持フレーム14、16は、図2、3に示す ように、断面コ字状をなし、垂直部14b、16bを介 して上水平部14a、16aにぞれぞれ水平な下水平部 14 c、16 cを有している。

【0015】次に、これら上アーム3及び下アーム4を 進退させるための駆動手段2を説明する。前述した断面 コ字状のアーム支持フレーム14、16の下水平部14 c、16cの下面には、基台19の上方において適宜支 持されたブラケット20の上面に形成されたレール2 2、24に摺動可能に係合したガイド部17、18がそ れぞれ設けられている。図1に示すように、レール2 2、24はX方向(図1において上下方向)に平行に配 設されている。とれにより、アーム支持フレーム14お よび上アーム先端部10から構成される上アーム3と、 アーム支持フレーム 16 および上アーム先端部 12 から 構成される下アーム4は、何れもX方向に進退移助自在 になっている。

【0016】ブラケット20の上方には、X方向に離間 してプーリ30、32及びプーリ34、36が設けら れ、それらの内、プーリ30とプーリ34が対をなし、 プーリ32とプーリ36が対をなしている。なお、図2 は、プーリ30、32が配設された位置における縦断面 図を示し、図3は、プーリ34、36が配設された付置 における縦断面図を示している。ブーリ30とブーリ3 4には無端ベルト38が巻回され、また、プーリ32と プーリ36には無端ベルト40が巻回されている。ま 2を介して取り付けられた上アーム3及び下アーム4を 40 た、無端ベルト38はブラケット42によってアーム支 持フレーム14の下水平部14cに接続され、無端ベル ト40はブラケット43によってアーム支持フレーム] 4の下水平部14cに接続されている。

【0017】一方、プーリ30とプーリ32は、それぞ れ軸受44、45を介してプーリ46、48に同軸結合 され、プーリ46、48はそれぞれ駆動ベルト50、5 2を介してプーリ54、56に連結され、プーリ54、 56はそれぞれ駆動モータ58、60の回転軸に固着さ れている。

と、プーリ54、駆動ベルト50、プーリ46を介してプーリ30が回転し、プーリ30の回転駆動によって駆動ベルト38がX軸方向に移動し、駆動ベルト38と一緒に、アーム支持フレーム14および上アーム先端部10から構成される上アーム3が一体的にレール22上をX軸方向に移動するようになっていて、その移動方向によって決まる。また同様に、アータ60の回転軸が回転すると、プーリ56、駆動ベルト52、プーリ48を介してプーリ32が回転し、アーリ32の回転駆動によって駆動ベルト40がX軸方向により32の回転駆動によって駆動ベルト40がX軸方向により32の回転駆動によって駆動ベルト40がX軸方向にり32の回転駆動によって駆動ベルト40がX軸方向により32の回転駆動によって駆動ベルト40がX軸方向により32の回転があるとと、アームを対方向に移動するようになって決ちる。

【0019】図示の例では、以上の如く構成された駆動 手段2を覆うためのカバー70が、上記基台19の上に 装着されている。とのカバー70の上面には二つのスリ ット71及びスリット72が形成されていて、上記断面 コ字状のアーム支持フレーム14、16の垂直部14 b、16bが、それらスリット71及びスリット72内 に非接触状態で嵌入している。スリット71及びスリッ ト72の長さは、前述した上アーム3と下アーム4の進 退移助を妨げない長さに形成されている。 スリット7 1、スリット72の周縁から下方に向かって、カバー7 0内の気密性を高めるための帯板状に延伸形成されたス カート73、74がそれぞれ設けられている。そして、 前述のアーム支持フレーム14、16の下水平部14 c、16cを移動自在に支持しているレール22、2 4、各プーリ30、32、34、36、54、56、各 ベルト38、40、50、52、およびモータ58、6 0等の、駆動手段2の各構成部材が、このカバー70と 基台19によって密閉された空間内部に配置されること により、駆動手段2において発生したパーティクルがカ バー70の外部に飛散することを防止している。

【0020】一方、基台19には吸引管75が開口し、吸引手段である排気ファン76に該吸引管75の先端が接続されている。との排気ファン76の稼働によってカバー70内を常時負圧にすることにより、駆動手段2において発生したパーティクルを除去すると共に、前述のスリット71、スリット72から外部にパーティクルが漏れ出ることを防いでいる。なお、排気ファン76からの排気は、処理システムの底部からシステム外に排出される。

【0021】次に、本実施例の搬送装置126におけるアーム機構の動作、特に上アーム3の動作について説明する。なお、下アーム4も、上アーム3と同じ構成・機能を有しているので、上アーム4と同様の動作を行う。【0022】先ず、上アーム先端部10によってLCD基板Pを受け取るときは、搬送装置本体1の稼働によっ

て、駆動手段2と上アーム3及び下アーム4は所定の位 置に移動され、回転、昇降移動して、上アーム3及び下 アーム4が処理装置102~116もしくはローダ・ア ンローダ部100に対向した状態となる。これら処理装 置102~116もしくはローダ・アンローダ部100 には、これから取り出されるLCD基板Pがその支持ビ ンによって載置された状態になっている。上アーム3及 び下アーム4の移動終了後、駆動手段2においてモータ 58が作動し、上アーム先端部10が前進位置、つまり 基板保持部10aが処理装置102~116もしくはロ ーダ・アンローダ部100にあるLCD基板Pの四隅の 真下になる位置まで、前進移動(往動)する。そして、 搬送装置本体1の稼働によって駆動手段2と上アーム3 及び下アーム4が一体的に所定の高さだけ上昇移助する ことにより、LCD基板Pはローダ・アンローダ部10 0の基板支持ピン136または処理装置102~108 内の基板支持ピンから上アーム先端部10に移載され る。上アーム先端部10はほぼ水平状態でLCD基板P を支持ピンから受け取るので、LCD基板Pは上アーム 20 先端部10の4個の基板保持部10aで規定される矩形 の基板載置位置に正しく移載される。とうしてLCD基 板Pを上アーム先端部10で受け取った後、モータ58 が先と逆回転作動し、上アーム先端部10が基本位置、 つまり基板保持部10aが処理装置102~116もし くはローダ・アンローダ部100内からLCD基板Pを 完全に取り出した位置まで、後退移動(復動)する。 【0023】一方、上アーム先端部10によって保持し ているLCD基板Pを、処理装置102~116もしく はローダ・アンローダ部100に対し受け渡す場合は、 先ず同様に搬送装置本体1の稼働によって、駆動手段2 と上アーム3及び下アーム4は所定の位置に移動され、 回転、昇降移動して、上アーム3及び下アーム4が任意 の処理装置102~116もしくはローダ・アンローダ 部100に対向した状態となる。上アーム先端部10に は、4個の基板保持部10aによって所定位置に規定さ れたLCD基板Pが保持された状態になっている。上ア ーム3及び下アーム4の移動終了後、駆助手段2におい てモータ58が作動し、上アーム先端部10が所定位 置、つまり基板保持部10aによって保持しているLC 40 D基板Pを、処理装置102~116もしくはローダ・ アンローダ部100内に完全に収納させる位置まで、前 進移助(往跡)する。そして、搬送装置本体1の稼働に よって駆動手段2と上アーム3及び下アーム4が一体的 、に所定の距離だけ下降移動することにより、LCD基板 Pは上アーム先端部10からローダ・アンローダ部10 0の基板支持ピン136または処理装置102~108 内の基板支持ピンに移載される。LCD基板Pは4個の 基板保持部10aによって所定位置に規定されているの で、LCD基板Pはローダ・アンローダ部100の基板 50 支持ピン136または処理装置102~108内の基板

支持ピンの上に、正しく移載される。こうしてLCD基板Pをローダ・アンローダ部100もしくは処理装置102~108内に搬入した後、モータ58が先と逆回転作動し、上アーム先端部10が基本位置、つまり基板保持部10aが処理装置102~116もしくはローダ・アンローダ部100内から完全に退出する位置まで、後退移動(復動)する。

【0024】以上、上アーム3について説明したが、下アーム4によっても全く同様にLCD基板Pを処理室の任意の処理装置102~116もしくはローダ・アンローグ部100に適宜搬入し、また、処理装置102~116もしくはローダ・アンローダ部100からLCD基板Pを適宜搬出することができる。このように実施例の搬送装置126にあっては、上アーム3と下アーム4の二つを備えているので、一方のアームで処理装置102~116もしくはローダ・アンローダ部100からLCD基板Pを拠理装置102~116もしくはローダ・アンローダ部100に搬入することが可能である。

【0025】一方、以上のように駆動手段2の稼働によ 20 って上アーム3および下アーム4でLCD基板Pの搬入 ・搬出が行われると、レール22、24や各ベルト3 8、40、50、52などにおける摩擦、モータの回転 などに起因してパーティクルが発生しやすい。もしパー ティクルが被処理体に付着すると、LCD基板Pの性能 劣化、歩留まりの低下といった問題を引き起こすので好 ましくない。そこで、本実施例の搬送装置126にあっ ては、少なくともとうして駆動手段2が稼働している間 は、排気ファン76の稼働によってカバー70内を常時 負圧にすることにより、駆動手段2において発生したパ 30 ーティクルを除去する構成になっている。このように、 カバー70内を排気することに伴って、カバー70上面 に形成されたスリット71、スリット72から外気をカ バー70内に吸引することができるので、カバー70内 で発生したパーティクルが外部に漏れ出ることが無く、 上アーム3や下アーム4で保持したLCD基板Pにパー ティクルが付着することを防止できるといった特徴があ る。また、本実施例ではスリット71、スリット72の 下方にスカート73、74を設けることによって、カバ ー70内の気密性を高め、スリット71、72から外部 40 へのパーティクルの漏出をより効率的に防ぐ構成になっ ている。

【0026】以上、本発明にかかる搬送装置の好適な実施例について説明したが、何れにしても本発明によれば駆動手段において発生したパーティクルを効果的に除去できるので、被処理体にパーティクルが付着しないといった作用効果がある。但し、本発明は以上に説明した実施例に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内で種々の変形・変更が可能である。たとえば、本発明の搬送装置はLCD基板の搬送装置の他、半導体ウェハ

の搬送装置や、その他の高度な清浄さが要求される物品 の搬送装置において、同様に利用することができる。ま た、カバー70の形状、大きさ、スカート73、74の 長さなどは適宜設計変更することが可能である。また、 吸気管は、必ずしも基台19に開口させなくても良く、 例えばカバー70の側面や天井面に開口させてもかまわ ない。また、複数箇所に開口させることも可能である。 【0027】次に、図5を参考にして、以上のような搬 送装置126(128)における安全対策について説明 する。搬送装置126(128)において、作業者がメ ンテナンスを行っている場合には、搬送装置126(1 28) 自体の稼働を停止させる必要がある。例えば、L CD基板の搬送装置についていえば、LCD基板自体が 大きいため、その搬送装置も大型である。そして、メン テナンスを行う場合は作業者が搬送路120の中に入っ て、アーム3、4等の点検、修理等の作業を執り行う場 合もある。かような場合に誤って搬送装置 126 (12 8)を稼働させてしまうと、作業者が搬送装置本体]に 挟まれる心配があり、危険である。

【0028】そとで、図示の例では搬送路120の前後 両端に光反射型のセンサ80、81を取り付け、搬送装 置本体1の前後面には光反射板(ミラー)82、83を 配置するととによって、搬送路120内に人や物が入 り、光が遮断された場合には、搬送装置126(12 8) の稼働を停止させインターロックする構成になって いる。従って、との図5の搬送装置126 (128) に よれば、作業者が搬送路120の中に入って遮光してい るときは、搬送装置126(128)の稼働が停止した 状態が維持されることとなるので、'誤って作業者が搬送 装置本体1に挟まれる心配が無いといった特徴がある。 また、図示のように光反射型のセンサ80、81と光反 射板(ミラー)82、83の組合わせを利用すると、搬 送装置本体1が搬送路120の前後端に近付きすぎた場 合には光反射型のセンサの受光が妨げられることとな り、異常が検知できるといった利点がある。なお、この 図5の実施例において、作業者が搬送路120の中に入 っている場合に、警告灯(パトライト)や音声等の適当 な表示手段によって注意を促すようにすると、より効果 的である。なお、上記センサは、上下方向に複数設ける ようにしても良い。

【0029】次に、図6を参考にして、処理システムの受け渡し部124に、被処理体のアライメント機構90を設けた例について説明する。先に図4で説明したように、第1の搬送装置126と第2の搬送装置128の間では、受け渡し部124を介して被処理体の受け渡しが行われる。これは、特にLCD基板Pのような大型の被処理体を受け渡す場合は、その重さによってアームが提むので、第1の搬送装置126のアームと第2の搬送装置128のアームと間で、直接被処理体を受け渡すことが困難であることに基づく。従って、例えば第1の搬送

10

装置126から第2の搬送装置128に被処理体を受け渡す場合は、第1の搬送装置126によって搬送してきた被処理体を受け渡し部124に一旦置き、その後第2の搬送装置128によって被処理体を受け取るようにしている。またその逆に、第2の搬送装置128から第1の搬送装置126に被処理体を受け渡す場合も同様に、被処理体を受け渡し部124に一旦置いてから、被処理体の受け渡しを行っている。

【0030】そとで、図示の例では、受け渡し部124 に被処理体のアライメント機構90を設けることによっ て、第1の搬送装置126と第2の搬送装置128の間 で受け渡しを行う際に、受け渡し部124において一旦 位置合わせを行ってから被処理体を受け渡す構成になっ ている。アライメント機構90は、例えば図7に示すよ うに、被処理体Pの対向する角部をプッシャ91で対角 線上に押し合いながら位置合わせを行う構成、図8に示 すように、受け渡し部124にガイド92を立設してお き、被処理体Pを受け渡し部124においた際に、被処 理体Pの辺縁部をガイド92の傾斜に沿って案内して位 置合わせを行う構成、など適宜採用することができる。 何れにしても、受け渡し部124に被処理体Pのアライ メント機構90を設けることによって、被処理体Pを正 しい位置に保持したまま第1の搬送装置126と第2の 搬送装置128の間で受け渡すことができ、処理の円滑 さが失われないといった特徴がある。

[0031]

* 【発明の効果】本発明によれば、駆動手段において発生したパーティクルを効果的に除去できるといった効果がある。本発明によれば、被処理体をパーティクルの付着しない清浄な状態で搬送できるといった作用効果がある。

【図面の簡単な説明】

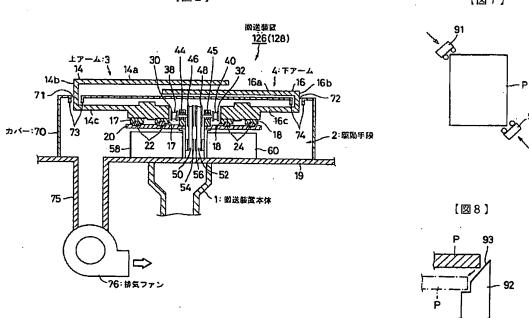
- 【図1】本発明の実施例に係る搬送装置の略平面図。
- 【図2】同実施例に係る搬送装置の基端部の構成を示す 縦断面図。
- 10 【図3】同実施例に係る搬送装置の先端部の構成を示す 縦断面図。
 - 【図4】処理システム全体の斜視図。
 - 【図5】安全対策を改善した搬送装置の説明図。
 - 【図6】処理システムの受け渡し部に被処理体のアライメント機構を設けた搬送装置の説明図。
 - 【図7】アライメント機構の説明図。
 - 【図8】図7とは異なる構成のアライメント機構の説明図。

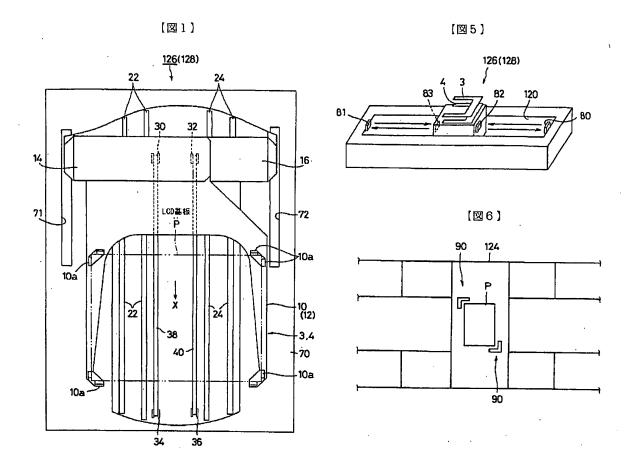
【符号の説明】

- 20 P LCD基板
 - 搬送装置本体
 - 2 駆動手段
 - 3、4 アーム
 - 70 カバー
 - 76 排気ファン
- * 126、128 搬送装置

【図2】

【図7】





126 (128)

3,4

14b

14

12

42

14a

43

16a

10

16

16b

72

70

71

14c

73

17

34

36

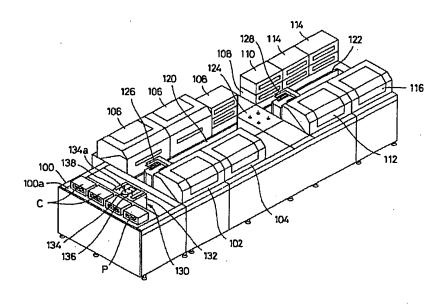
18

20

74

75

【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 立山 清久

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京 エレクトロン九州株式会社熊本事業所内